# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-113137

(43) Date of publication of application: 24.04.2001

(51)Int.CI.

B01D 61/48 C02F 1/44

CO2F 1/44 CO2F 1/469

(21)Application number : 11-295752

(71)Applicant: KURITA WATER IND LTD

(22)Date of filing:

18.10.1999

(72)Inventor: KONISHI AKIYOSHI

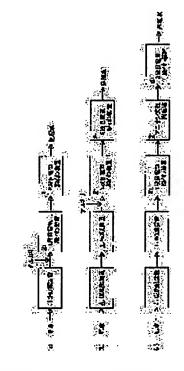
SATO SHIGEAKI

# (54) PRODUCTION DEVICE OF HIGH PURITY OF WATER AND PRODUCTION METHOD OF HIGH PURITY OF WATER

## (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To produce high purity of water having much higher purity and being stable in water quality for a long period.

SOLUTION: When raw water is successively passed through an RO membrane device 1, a first stage electric deionizing device 2 and a second stage electric deionizing device 3 to treat water, a decarboxylation device 4 is provided in the front stage of the RO membrane device 1; alkali is added to feeding water of the first stage electric deionizing device 2; or an anion exchange resin tower 5 is provided between the first stage electric deionizing device 2 and the second stage electric deionizing device 3.



### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

28.09.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of rejection or application converted registration]
[Date of final disposal for application]
[Patent number]
[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (J P)

# (12) 公開特許公報(A)

(II)特許山壤公開發号 特開2001-113137

(P2001-113137A)

(43)公顷日 平成13年4月24日(2001.4.24)

(51) Int.CL'		識別配号	ΡI		5	-73-1*(参考)
B01D	61/48		BOID	61/48		4D006
C02F	1/44		C02F	1/44	J	4D061
	1/489			1/48	103	

#### 審査部球 未韶球 韶球項の数6 OL (全 7 四)

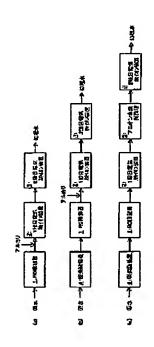
<b>特顯平11−295752</b>	(71) 出項人	000001063
		栗田工業株式会社
平成11年10月18日(1999.10.18)		東京都新宿区西新宿 8 丁目 4 番 7 号
	(72) 発明者	小西 日警
		東京都新宿区西新宿三丁目4番7号 栗田
		工業旅式会社内
	(72) 発明者	佐藤 重明
		東京都新宿区西新宿三丁目4番7号 栗田
		工器採式会社内
	(74)代理人	100088911
	V 477	弁理士 重野 剛
		最終質に続く
		平成11年10月18日 (1999, 10, 18) (72)発明者 (72)発明者

#### (54) 【発明の名称】 高純度水の製造装置及び高純度水の製造方法

#### (57)【要約】

【課題】 より高純度で水質の安定した高純度水を長期 に亘り連続的に製造する。

【解決手段】 原水をRO職装置1.1段目電気脱イオン装置2及び2段目電気脱イオン装置3に順次追水して処理するに当り、RO順装置1の前段に脱炭酸装置4を設ける:1段目電気脱イオン装置2の結水にアルカリを添加する;或いは、1段目電気脱イオン装置2と2段目電気脱イオン装置3との間にアニオン交換制脂塔5を設ける。



特闘2001-113137

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 逆浸透膜装置と該逆浸透膜装置の後段に 設けられた第1の電気脱イオン藝畳と、該第1の電気脱 イオン装置の後段に設けられた第2の電気脱イオン装置 とを有する高純度水の製造装置であって、

1

該逆浸透膜装置の前段に設けられた脱炭酸手段と、該逆 浸透膜装置と第1の電気脱イオン装置との間に設けられ たアルカリ添加手段とのいずれか一方又は双方を有する ことを特徴とする高純度水の製造鉄置。

【請求項2】 逆浸透膜装置と該逆浸透膜装置の後段に 10 設けられた第1の電気脱イオン装置と、該第1の電気脱 イオン装置の後段に設けられた第2の電気脱イオン装置 とを有する高純度水の製造装置であって、

該第1の電気脱イオン装置と第2の電気脱イオン装置と の間にアニオン交換装置を有することを特徴とする高純 度水の製造装置。

【請求項3】 請求項2において、該逆浸透膜装置の前 段に設けられた民炭酸手段を有することを特徴とする高 純度水の製造装置。

ン装置及び第2の電気脱イオン装置に順次通水して高絶 度水を製造する方法であって、

該道浸透膜装置への通水に先立つ原水の脱炭酸処理と、 該第1の電気脱イオン装置への通水に先立つ逆浸透膜装 置の処理水へのアルカリ添加とのいずれか一方又は双方 を採用することを特徴とする高純度水の製造方法。

【請求項5】 原水を逆浸遠膜装置、第1の電気脱イオ ン装置及び第2の電気脱イオン装置に順次通水して高純米 \* 度水を製造する方法であって、

該第1の電気脱イオン装置の処理水をアニオン交換処理 した後、該第2の電気脱イオン装置に通水するととを特 徴とする高純度水の製造方法。

2

【請求項6】 請求項5において、該逆浸透膜装置への 通水に先立ち原水を脱炭酸処理することを特徴とする高 純度水の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

(2)

【発明の属する技術分野】本発明は高純度水の製造装置 及び高純度水の製造方法に係り、特に、逆浸透(RO) 膜装置と、このRO膜装置の後段に2段に設けられた電 気脱イオン装置に原水を順次通水することにより、より 高純度で水質の安定した高純度水を迫続的に製造する高 純度水の製造装置及び高純度水の製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、RO磺基置と電気脱イオン禁置と を組み合わせ、更に必要に応じて残段にイオン交換制脂 塔を設けて高純度化を図った純水製造装置が公知であ

【請求項4】 原水を逆浸透膜装置。第1の電気脱イオー20 り、とのような装置において、夏に純度を向上するため にRO膜装置を2段に設けたものや前段にアニオン交換 萄脂塔を設けたものも提案されている。

> 【0003】従来の装置構成において、シリカ20mg /し、ポロン0. 2mg/し、比抵抗0. 004MQ・ cm. 炭酸ガス約5mg/Lの原水を処理した場合、各 装置の処理水の水質は下記の通りである。

[0004]

【表1】

(図2(a)の場合)

(@s(s; w;gh)					
	原水	1段目 RO膜玻密 処理水	2於目 ROID技艺 処理水	電気脱イオン装置 処理水	
シリカ (mg/L)	20	1. 0	0 1	0 01	
ポロン (mg/L)	O. 2	0. 02	0. 003	0. 0005	
比据抗 (Mり·cm)	0. 004	0. 3	2.0	17 5	

[0005]

【表2】

(図2(b)の場合)

122:0:07:327						
	原水	RO模装置 処理水	電気脱イオン装置 処理水			
シリカ (mg/L)	20	10	0. 1			
ボロン (mg/L)	0. 2	C. 02	0.003			
比抵抗 (MQ vcm)	0.004	U. 3	17.0			

[0006] 【表3】

40

(6)5/6)0/48/5)					
	原水	アニオン 交換樹間塔 処理水	RO脱裝置 処理水	電気脱イオン装置 処理水	
シリカ (mg/L)	20	0. 2	0. 02	0. 002	
ポロン (mg/L)	0. 2	0. 02	0. 003	0. 0005	
比抵抗 (MQ·cm)	0, 004	0, 004	0, 3	17. 6	

(3)

#### [0007]

【発明が解決しようとする課題】上記従来の純水製造装 置では、シリカロ、005mg/L以下、ポロンロ、0 005mg/L以下、比抵抗17.5MQ・cm以上を 処理水の水質の目標値とした場合、図2(a)に示す如 く2段RO順装置と電気脱イオン装置とを組み合わせた もの、及び、図2(b)に示す如くRO膜装置と電気脱 イオン装置とを組み合わせたものでは、この水質の目標 値に到達するためには、更に後段に非再生型復床式イオ ン交換装置等のイオン交換装置を設置する必要があり、 そのための装置コストや設置スペースが閉題となる。し 20 【0014】請求項5の高純度水の製造方法は、原水を かも、その場合においても、ボロンの低濃度化は困難で あり、また水質が安定せず、その上、イオン交換装置の 交換や再生が必要であるために長期迫続運転に適さない という欠点がある。

【0008】また、図2(c)に示す如くアニオン交換 樹脂塔、RO膜装置及び電気脱イオン装置を組み合わせ たものでは、ほぼ目標水質に到達するが、RO膜装置の 前段のアニオン交換樹脂塔の負荷が大きく、装置コスト や設置スペース、更にはアニオン交換樹脂の再生等の面 で不利である。

【0009】本発明は上記従来の問題点を解決し、より 高純度で水質の安定した高純度水を長期に亘り連続的に 製造することができる高純度水の製造装置及び高純度水 の製造方法を提供することを目的とする。

#### [0010]

【課題を解決するための手段】請求項1の高純度水の製 造装置は、RO膜装置と該RO膜装置の後段に設けられ た第1の電気脱イオン装置と、放第1の電気脱イオン装 置の後段に頷けられた第2の電気脱イオン装置とを有す る高純度水の製造装置であって、該RO膜装置の前段に 40 続道転が可能となる。 設けられた脱炭酸手段と、該RO膜装置と第1の電気脱 イオン装置との間に設けられたアルカリ添加手段とのい ずれか一方又は双方を有することを特徴とする。

【0011】請求項2の高純度水の製造装置は、RO膜 装置と該RO膜装置の役段に設けられた第1の電気脱イ オン装置と、該第1の電気脱イオン装置の後段に設けら れた第2の電気脱イオン装置とを有する高純度水の製造 装置であって、該第1の電気脱イオン装置と第2の電気 脱イオン装置との間にアニオン交換装置を有することを 特徴とする。

【0012】この請求項2の高純度水の製造装置におい て、RO膜装置の前段に脱炭酸手段を設けるのが好まし

【0013】請求項4の高純度水の製造方法は、原水を RO機装置、第1の電気脱イオン装置及び第2の電気脱 イオン装置に順次通水して高純度水を製造する方法であ って、該RO購装置への追水に先立つ原水の脱炭酸処理 と、該第1の電気脱イオン装置への道水に先立つRO膜 装置の処理水へのアルカリ添加とのいずれか一方又は双 方を採用することを特徴とする。

RO膜装置、第1の電気脱イオン装置及び第2の電気脱 イオン装置に順次通水して高純度水を製造する方法であ って、該第1の電気脱イオン装置の処理水をアニオン交 換処理した後、 該第2の電気脱イオン装置に通水するこ とを特徴とする。

【0015】との請求項5の高純度水の製造方法におい て、RO膜装置への通水に先立ち原水を脱炭酸処理する のが好ましい。

【0016】従来の絶水製造装置では、電気脱イオン装 30 置を1段のみで使用しているが、本発明においては、電 気脱イオン装置を2段に直列に配置してシリカやボロン を高度に除去し、処理水の比抵抗を高める。即ち、電気 脱イオン装置を2段に設けると、2段目の電気脱イオン 装置では、1段目の電気脱イオン装置においてシリカや ボロンが十分に除去され、比抵抗も十分に向上した水を 処理することになることから、2段目の電気脱イオン袋 置では原水(給水)条件が、性能面、回収率、電圧電流 負荷に対して良好なものとなるため、得られる処理水の 水質は著しく高くなり、水質が安定すると共に、長期連

【0017】なお電気脱イオン装置はコンパクトである ため、2段設けても装置設備が過度に大型化することは なく、設置スペース面でも問題になることはない。

【0018】しかも、本発明では、とのようにRO膜袋 置と2段に設けた電気脱イオン装置で処理するに当た

の 脱炭酸処理することにより原水の炭酸ガス遺度を下

② 第1の電気脱イオン装置の給水にアルカリを添加す 50 ることにより第1の電気脱イオン装置におけるシリカや 炭酸ガス除去率を高める。

③ 第1の電気脱イオン装置の処理水をアニオン交換処 理してより純度を高めると共に、アニオン交換処理によ りpHを高めた水を第2の電気脱イオン装置に鉛水する ことにより、第2の電気脱イオン装置においてシリカを 高度に除去する。ことで、著しく高純度の処理水を得る ことができる。

【①①19】即ち、原水を脱炭酸処理して電気脱イオン 装置の炭酸ガス負荷を軽減することで、 電気脱イオン装 置の脱塩室内のイオン交換樹脂面及びイオン交換膜面で 10 る。 のシリカ、ボロン、その他の塩類に対する吸着、移動速 度を向上させ、これらの除去性能を高めることができ る.

【10020】また、電気脱イオン装置の給水のpHを高 めることにより、炭酸ガスが重炭酸イオンに変化する と、電気脱イオン装置の脱塩室から遺稿室側へ容易に移 動するようになり、脱イオン効率が高まる。

【0021】特に、前処理として脱炭酸装置を設けて原 水の炭酸ガス濃度を下げ、また、1段目電気脱イオン藝 置と2段目電気脱イオン装置との間にアニオン交換樹脂 20 度の処理水を得ることができる。 塔を設置することにより、2段目電気脱イオン装置の給 水のp目を高め、かつ、シリカ、ボロン、炭酸ガスを見 に除去することとなり、その結果、シリカトータル除去 率99.999%以上、ボロントータル除去率99%以 上、比抵抗値17.5ΜΩ・cm以上の性能を確実に得 ることができ、2段目電気脱イオン装置の処理水とし て、シリカ濃度0.0001mg/L以下、ボロン濃度 0.0001mg/L以下, 比抵抗値18.0MΩ·c mと若しく高純度の処理水を得ることができる。

[0022]

【発明の真施の形態】以下に図面を参照して本発明の真 施の形態を詳細に説明する。

【()()23】図1(a)~(c)は本発明の高純度水の 製造装置及び高純度水の製造方法の実施の形態を示す系 統図である。

【0024】本発明において、処理する原水は、市水 (水道水)、地下水(弁戸水)、河川水、その他使用済 絶水の回収水等である。

【0025】図1(a)の高純度水の製造装置は、原水 をR O膜装置1、1段目電気脱イオン装置2及び2段目 40 電気脱イオン装置3に順欠道水して処理するに当たり、 1段目電気脱イオン装置2に給水されるRの膜装置1の 透過水にNaOH、KOH等のアルカリを添加して1段 目電気脱イオン装置2の結水のpHを6.5以上、好き しくは8.0~12.0に調整して処理を行うものであ

【0026】図1(1)の高純度水の製造装置は、図1 (a)の高純度水の製造装置に更に前処理装置として脱 炭酸装置4を設け、原水を脱炭酸処理した後、RO膜装 オン鉄置2及び2段目電気脱イオン装置3に順次通水し て処理するものである。

【0027】図1(c)の高純度水の製造装置は、図1 (b) の高純度水の製造装置において、アルカリば加の 代りに1段目電気脱イオン鉄置2と2段目電気脱イオン 藝麗3との間にアニオン交換制脂塔5を設け、原水を脱 炭酸装置4で脱炭酸処理した後、RO膜装置1.1段目 電気脱イオン装置2、アニオン交換樹脂塔5及び2段目 電気脱イオン装置3に順次道水して処理するものであ

【0028】本発明においては、このように、原水をR O膜装置 1、 1段目電気脱イオン装置 2及び 2段目電気 脱イオン装置3に順次通水して処理するに当たり、アル カリ添加、脱炭酸処理、アニオン交換処理を組み込むこ とにより、1段目電気脱イオン装置2及び/又は2段目 電気脱イオン装置3の給水が好ましくは次のような水質 となるように調整し、1段目電気脱イオン装置2の水回 収率を50~95%、2段目電気脱イオン装置3の水回 収率を50~96%で通水することにより、著しく高純

[0029]

【表4】

	硬度(mg/L)	<6.0
	シリカ (mg./L)	<2.0
1段目の 電気関イオン装置	労政ガス(mg/L)	<2, 9
の治水条件	比抵抗(MΩ·cm)	>0. 01
	Hq	>6 5
	水温 (℃)	5~50

[0030]

【表5】

30

	硬度(mg/L)	<5 0
	シリカ (mg/L)	≺1.0
2段目の 電気配イオン接近	労務ガス(me/L)	<2.0
の給水条件	比抵抗(MΩ rem)	10 .0<
	pH .	>6. 5
	水温 (℃)	5~50

【① 031】従って、本発明では、電気脱イオン装置の 給水として上述のような水質範囲が達成されれば良く、 例えば、図1(b)の高純度水の製造装置において、ア ルカリ添加を省略しても良く、また。図1 (c) の高純 度水の製造装置において、脱炭酸装置を省略しても良

【0032】なお、上記水質を確保する上で、原水は必 蹬1で処理し、アルカリでpH調整後、1段目電気腕イ 59 要に応じて除濁装置、活性炭塔、或いは軟水器等で前処

(5)

特闘2001-113137

選した後、本発明に従って処理するのが好ましい。 [0033]

【実施例】以下に実施例及び比較例を挙げて本発明をよ り具体的に説明する。

【0034】なお、以下において、原水としては、上水 (井水) を活性炭塔で処理した後、軟水器で硬度成分を 除去した水(水温21~24℃)を用いた。この原水の 水質は次の通りであり、処理水量は4001/11とし tc.

#### (原水水質)

シリカー: 30 mg/L ポロン : 0.05mg/L 炭酸ガス: 8 mg/L

7. 2 ρН

比低抗 : 0. 004MQ·cm

また。用いたRO膜装置、1段目電気脱イオン装置、2 段目電気脱イオン装置、脱炭酸装置及びアニオン交換樹 脂塔の仕様及び運転条件は次の通りである。

【0035】R〇膜装置:低圧スパイラル型モジュー

ル、ポリイミド系合成復合膜

水回収率: 30%

通水圧力: 6.4kg/cm² (6.27×10°P

1段目電気脱イオン装置: 脱塩室と遺稿室にアニオンと\*

\*カチオンとの混合イオン交換樹脂を充填したオールフィ

ルド型

水回収率: 88% 98V 驾田 電流 : 0.4A

2段目電気脱イオン装置:1段目電気脱イオン装置と同

じ型を使用

水回収率: 90% : 100V 弯圧 10 電流 : 0. 04A

脱炭酸装置:外圧式中空糸型脱気膜(膜材質:ポリプロ

アニオン交換樹脂塔:強塩基性アニオン交換樹脂量15

L(1基) 真毡倒1

図】(a)に示す高純度水の製造装置で原水を処理し た。アルカリとしてはNaOHを用い、1段目電気脱イ オン装置2の給水のpHが9となるように添加した。

【0036】各段階における水質及び除去率は次の通り

20 であった。なお、除去率は原水中の造度に対して各段階 における濃度から求めた値である。

[0037] 【表6】

		RO設盤置1 の透過水 (アルカリ尿加前)	1段目電気脱イオン装置2 の 給 水 (アルカリ添加数)	1位目電気脱イオン装置2の 処理 水	2段日写気脱イオン装置S の 児 理 水
シリカ	浸度 (mg/L)	0. 98	Q. 98	0. 05	C. 0035
シリカ	学士等 (36)	97	_	99 8	ଥର. ଓଡ
*	温度 (mg/L)	0. 015	Ø. O15	0. 0009	0. 0001
ボロン	率表創 (%)	70	_	98. 2	99. 8
	ガス譲庶 ng/L)	6	<0.05	<0. G5	<0.05
	pН	5 9	9	7. 2	_
比如抗 (MQ -cm)		03	0 09	; 12. O	17 6

【0038】実施例2

った。

図1(c)に示す高純度水の製造装置で原水を処理した ところ、各段階における水質及び除去率は次の通りであ 40 【表7】

[0039]

特闘2001-113137

10

9

		-				
		配供配数面4 の処理水	RO版装置1 の透過水	1 段 日 電気取イオン装置2 の 処 取 水	アニオン交換総職 数5 の 処 選 水	2 段 目 電気照イオン袋置3 の 角 羽 木
シリカ	温度 (mg/L)	30	O. 68	0 03	0. 005	<0.0001
	降去學 (%)	_	97	69.8	99. 98	99. 939<
ポロン	選度 (mg/L)	0. 05	0. 015	0. 0009	0. 2001	<0. 0001
	率 (%)	_	70	98. 2	9D. 8	99. 8<
	ガス選度 セノレ)	1. 8	1 5	<0.05	<0, 05	<0.05
	pHI	7 9	7. 3	7. 3	8	_
	t抵抗 O·em)	0.004	03	10	12	15. 0

#### 【0040】比較例1

図2(り)に示す高純度水の製造装置で原水を処理し た。なお、電気脱イオン装置としては脱塩室と遺稿室に アニオンとカチオンの混合イオン交換樹脂を充填したオ ールフィルド型を用い、水回収率85%、電圧115 V、電流0.5Aで処理を行った。

【①①41】各段階における水質及び除去率は次の通り 20 【図面の簡単な説明】 であった。

[0042]

【表8】

		RO競装置 の透過水	電気祭イオン装置 の 処 理 水		
シリカ	遠度 (mg/L)	0. 98	0. 15		
293	率空和 (%)	97	99. 5		
ポロン	流度 (mg/L)	0. 015	0. 0023		
#507	除去路 (%)	70	95 4		
	ガス造度 セ/し)	6	-		
рН		6	_		
	滤技 Ω·cm)	0. 3	17. 0		

【発明の効果】以上詳述した通り、本発明によれば、よ り高純度で水質の安定した高純度水を長期に亘り連続的 に製造することができるため、後段の装置設備の負荷を 軽減して装置のコンパクト化、設備コストの低減を図る ことができる。

【図1】本発明の真施の形態を示す系統図である。

【図2】従来例を示す系統図である。

【符号の説明】

1:RO膜装置

2:1段目電気脱イオン装置

3:2段目電気脱イオン装置

4:脱炭酸姜属

5:アニオン交換樹脂塔

30

特闘2001-113137

(7)

[図1] 2股行發展 3股行效性 3股份>被压 [図2] 2段目 80数数置 電点 助付が混定 電点 脱伏を置 

フロントページの続き

Fターム(参考) 40006 GA03 KA02 KA71 KA72 KB11 K817 PB23 PB70 PC02 40051 DA02 DB15 DC13 DC18 EA09 EB13 FA09 FA20

ROUSE